03,11

Особенности распределения электронной плотности в теллуриде сурьмы Sb₂Te₃

© В.Г. Орлов^{1,2}, Г.С. Сергеев^{1,¶}

 ¹ Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
 ² Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Россия
 [¶] E-mail: Sergeev_GS@nrcki.ru

(Поступила в Редакцию 21 декабря 2016 г.)

На основе результатов расчетов электронной зонной структуры полупроводников Sb₂Te₃, Ge, Te и полуметалла Sb, выполненных методом функционала электронной плотности, найдены параметры критических точек в распределении электронной плотности (максимумов, минимумов и седловых точек) в кристаллической решетке вышеуказанных веществ. Полученные данные использованы для анализа природы химической связи в Sb₂Te₃.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-32-00107.

DOI: 10.21883/FTT.2017.07.44587.454

1. Введение

Теллурид сурьмы Sb_2Te_3 является узкозонным полупроводником, обладающим высокой термоэлектрической эффективностью [1]. В последние годы электронные свойства соединения Sb_2Te_3 привлекли особое внимание, поскольку первопринципные теоретические расчеты и результаты измерений методом фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) показали, что Sb_2Te_3 обладает электронной структурой, в которой нижняя зона проводимости имеет одиночный дираковский конус. Это позволяет отнести Sb_2Te_3 к классу топологических изоляторов [2].

Кроме того, соединение Sb₂Te₃ принадлежит также к классу псевдобинарных сплавов $(GeTe)_m - (Sb_2Te_3)_n$, которые получили название материалов с изменяемым фазовым состоянием (phase change materials (PCM)) изза уникальной способности переходить из кристаллического состояния в аморфное и совершать обратный переход в кристаллическую фазу под действием лазерного излучения или импульса электрического тока за необычайно короткие времена порядка 1-100 ns. PCM в настоящее время используются для изготовления различных видов оптической перезаписываемой памяти компакт-дисков (CD), цифровых универсальных дисков (DVD), дисков на основе Blu-Ray технологии [3]. Высоко также оцениваются потенциальные возможности создания на основе РСМ энергонезависимой электронной памяти [4,5].

Востребованность РСМ в практически важных приложениях для хранения данных обусловлена сочетанием их уникальных свойств: заметным различием оптических характеристик (коэффициентов отражения и пропускания лазерного света в широком спектральном диапазоне) в аморфном и кристаллическом состоянии [6], малыми временами и низким энергетическим порогом кристаллизации и аморфизации под действием лазерного излучения [7] или импульса электрического тока [8], резким увеличением электросопротивления при переходе из кристаллического в аморфное состояние [8,9], стабильностью фазового состояния в области температур от комнатной до 150–200°С и способностью выдерживать большое число циклов перезаписи данных без заметного ухудшения свойств ячейки памяти [8].

Уникальность РСМ на основе $(GeTe)_m - (Sb_2Te_3)_n$ сплавов вызывает вопрос о связи рекордных параметров РСМ с особенностями их электронного строения. Признано, что выяснение природы химической связи в РСМ является ключевым моментом для понимания их свойств [5]. В ряде работ для описания кристаллических и аморфных полупроводников [10] и РСМ [5,11] привлекалась идея о резонансной связи (resonance bonding), высказанная Полингом в его книге [12]. Основанная на квантовомеханических расчетах электронной структуры простейших двухатомных молекул, эта идея была, несомненно, полезна для качественного анализа свойств существенно более сложных многоатомных молекул. Но с появлением мощных ЭВМ и развитием численных методов расчетов электронной структуры молекул и конденсированных сред появилась возможность как качественного, так и количественного анализа влияния особенностей электронной структуры на свойства вещества.

В настоящей работе выполнены первопринципные расчеты электронной зонной структуры соединения Sb₂Te₃, а также веществ Ge, Te и Sb, входящих в состав PCM. На основе полученных результатов проведен анализ распределения электронной плотности в исследованных соединениях, позволяющий выявить наличие особенностей в электронной структуре, которые характерны для PCM.

Метод расчета электронной зонной структуры и анализа распределения электронной плотности

Наибольшую популярность в области численного моделирования электронных свойств молекул и конденсированных сред приобрел метод функционала электронной плотности (Density Functional Theory (DFT)), основанный на теоремах Хоэнберга–Кона [13] и формализме Кона–Шэма [14]. Метод DFT позволил свести сложную задачу о поведении большого числа взаимодействующих электронов, помещенных в кулоновский потенциал атомных ядер, к задаче о невзаимодействующем электронном газе, находящемся в эффективном потенциале, который учитывает как электростатический потенциал ядер, так и обменно-корреляционные эффекты в электронной подсистеме. При этом энергия электронной подсистемы является функционалом электронной плотности $\rho(\mathbf{r})$, зависящей только от радиус-вектора \mathbf{r} .

За время, прошедшее с момента публикации работ [13,14], было создано несколько десятков программных пакетов для расчетов электронной структуры конденсированных сред, некоторые из которых (ABINIT, LMTO, CASTEP, VASP) были использованы для исследования механизма химической связи в РСМ, а также для установления корреляции между наличием вакансий и локальных искажений структуры в РСМ и процессами их кристаллизации и аморфизации [15-19]. Однако результаты расчетов электронной зонной структуры, дающие чрезвычайно полезные сведения, например о полной электронной энергии основного состояния вещества, и позволяющие сделать вывод о предпочтительности той или иной кристаллической структуры, сами по себе не предоставляют информацию о природе механизма химической связи в веществе на атомном уровне. Для наглядной визуализации роли электронной плотности в химической связи в РСМ авторы цитированных выше работ использовали такие методы как CDD (charge density difference — разность зарядовой плотности в веществе и в атомах, входящих в состав вещества) [15,17-19] и СОНР (crystal orbital Hamilton population — представление энергии зонной структуры в виде вкладов от различных межатомных взаимодействий) [16].

Между тем в квантовой химии разработан и широко используется метод нахождения особенностей в распределении электронной плотности $\rho(\mathbf{r})$ молекул [20], основанный на анализе матрицы вторых производных электронной плотности по координатам, называемой матрицей Гессе, или гессианом

$$(\partial^2 \rho / \partial x_i \partial x_j),$$
 (1)

где *i*, *j* = 1, 2, 3, $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$. При этом электронная плотность $\rho(\mathbf{r})$, которая находится либо из экспериментов, либо расчетным путем, рассматривается как скалярное поле. Точки \mathbf{r}_c , в которых градиент электронной плотности обращается в нуль $\nabla \rho(\mathbf{r}_c) = 0$,

называются критическими. В этих точках электронная плотность обладает экстремальными свойствами (имеет минимум или максимум, а также может быть седловой точкой). Диагонализуя симметричную матрицу Гессе ρ , можно найти ее собственные значения λ_i (i = 1, 2, 3) и координатные оси — главные оси кривизны, для которых недиагональные элементы матрицы равны нулю. Сумма диагональных матричных элементов — лапласиан $\nabla^2 \rho = \frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho}{\partial z^2}$ выполняет важную роль в анализе особенностей в распределении электронной плотности. Знак лапласиана и его величина в критической точке служат одним из признаков типа химической связи [20]. Отрицательный знак лапласиана в критической точке $abla^2
ho_b < 0$ свидетельствует о натекании заряда в критическую точку от атомов, между которыми данная критическая точка расположена. Напротив, положительный знак лапласиана $\nabla^2 \rho_b > 0$ говорит о выталкивании заряда из области вблизи критической точки. Собственные значения λ_i симметричной матрицы Гессе ρ (главные значения кривизны) действительны, могут иметь любой знак, а также равняться нулю. Классификация особых точек ρ осуществляется по рангу ω — числу ненулевых главных значений кривизны и сигнатуре σ — алгебраической сумме их знаков: (ω , σ). Критическая точка (3, -3) отвечает локальному максимуму р. Несмотря на то что в местах расположения ядер атомов, входящих в молекулу, $\nabla \rho$ терпит разрыв, в равновесном состоянии молекул локальные максимумы электронной плотности ρ на ядрах, называемые nucleus, рассматриваются как критические точки с параметрами (3, -3) [20]. Критическая точка (3, +3) представляет собой локальный минимум в распределении электронной плотности и носит название клетки (cage). Из двух седловых критических точек (3, +1)-кольцо (ring) и (3, -1)-связь (bond); последняя, как следует из названия, играет важную роль в классификации типа химической связи.

Использование метода критических точек в распределении электронной плотности для анализа природы химической связи в кристаллах [21,22] оказалось столь же востребованным, как и в химии молекул. В простейшем варианте классификации типов химической связи в кристаллах в качестве критериев рассматриваются знак лапласиана электронной плотности $abla^2
ho_b$ в седловой критической точке типа bond (3, -1), знаки и соотношения абсолютных величин главных значений кривизны λ_i (*i* = 1, 2, 3) в данной критической точке, величина заряда ρ_b , а также характер распределения электронной плотности в межатомной области кристалла. В частности, ковалентная связь характеризуется отрицательным знаком лапласиана $\nabla^2 \rho_b < 0$, отрицательными значениями $\lambda_{1,2} < 0$, большими по абсолютной величине $|\lambda_{1,2}| > \lambda_3$, большим значением электронной плотности в критической точке ρ_b . В то время как для ионной связи $\nabla^2 \rho_b > 0$, $|\lambda_{1,2}| \ll \lambda_3$, ρ_b мало, зарядовая плотность концентрируется в основном в областях расположения атомов [21,22].

	Ge	Sb	Te	Sb ₂ Te ₃	
Параметры решетки, Å ссылки	a = 5.658 [28]	$egin{aligned} a_{ m h} &= 4.308 \ c_{ m h} &= 11.274 \ a_{ m rh} &= 4.507 \ lpha &= 57.11^\circ \ & [29] \end{aligned}$	a = 4.456 c = 5.923 [30]	$\begin{array}{c} a_{h}=4.264\\ c_{h}=30.458\\ a_{rh}=10.447\\ \alpha=23.55^{\circ}\\ [31] \end{array}$	
Пространственная группа	227 Fd3m	166 R3m	152 Р3 ₁ 21 или 153 Р3 ₂ 21	166 R3m	
Щель, eV, расчет	0.749	Полуметалл	0.478	0.148	
Щель, eV, эксперимент ссылки	0.74 [32]	_	0.335 [33]	0.21 [34]	

Таблица 1. Экспериментальные значения параметров решеток кристаллов, использованные в расчетах, теоретические и экспериментальные значения полупроводниковой щели

В настоящей работе с помощью пакета программ WIEN2k (версия 14.2) [23] выполнены расчеты электронной зонной структуры соединения Sb₂Te₃, принадлежащего классу псевдобинарных сплавов (GeTe)_m-(Sb₂Te₃)_n, обладающих свойствами РСМ, а также кристаллов полупроводников Ge, Te и полуметалла Sb. Вычисления проводились методом FPLAPW (Full Potential Linearized Augmented Plane Wave) c использованием модифицированного Траном и Блахой обменно-корреляционного потенциала Беке и Джонсона [24] (mBJ — modified Becke–Johnson exchange potential + LDA-correlation), который позволяет получать корректные значения диэлектрической щели в полупроводниках и оксидах [25]. Также учитывалось спинорбитальное взаимодействие и релятивистские поправки. Для обеспечения необходимой точности при расчетах использовались следующие параметры: разложение по *l*-орбитальному моменту проводилось внутри атомных сфер до $l_{\text{max}} = 10$, радиусы атомных сфер R_{min} брались равными 2.3, 2.1 и 2.3 at.units для Ge, Te и Sb соответственно. Максимальное значение волнового вектора k_{max}, использующееся при разложении по плоским волнам, определялось условием $R_{\min} \cdot k_{\max} = 8.0$, общее число точек в зоне Бриллюэна выбиралось равным 2000 для всех исследуемых веществ.

Вычисления проводились на многоцелевом вычислительном комплексе НИЦ "Курчатовский институт" [26].

Поиск критических точек в распределении электронной плотности, полученной с помощью программного комплекса WIEN2k, проводился на основе программы Critic 2 [27], предназначенной для топологического анализа скалярных полей в периодических структурах.

В расчетах параметры кристаллических решеток веществ брались из экспериментальных данных, приведенных в табл. 1. Указанные в табл. 1 параметры решетки были измерены при комнатной температуре. Для кристаллов Sb и Sb₂Te₃, имеющих ромбоэдрическую симметрию, параметры решеток даны в двух вариантах осей — гексагональных (a_h, c_h) и ромбоэдрических (a_{rh}, α) . В табл. 1 также приведены экспериментальные и рассчитанные в настоящей работе величины полупроводниковых щелей.

3. Результаты и обсуждение

Результаты поиска критических точек в распределении электронной плотности кристаллов Ge, Sb, Te, а также соединения Sb₂Te₃ приведены в табл. 2. В частности, в табл. 2 дана информация о типах критических точек, их количестве N_c и типе позиций высокой симметрии, которые занимают критические точки в решетке кристалла. Также в табл. 2 указаны координаты (x, y, z) в долях от параметров решетки) одной из критических точек каждого типа, величины главных значений кривизны λ_i (*i* = 1, 2, 3) распределения электронной плотности в данной критической точке, значения лапласиана $\nabla^2 \rho_c$ и значение ρ_c в критической точке. У веществ со структурами, описываемыми пространственной группой № 166 $R\bar{3}m$, координаты критических точек приведены в долях от параметра решетки в ромбоэдрических осях *a_{rh}*. Для критических точек типа nucleus параметры не приведены в силу их нефизичности.

Пространственно-групповая симметрия накладывает ограничения на типы и позиции критических точек. У всех исследованных нами веществ критические точки располагаются в позициях высокой симметрии пространственных групп кристаллов [35], указанных в табл. 1. При этом количество критических точек в элементарной ячейке кристаллов удовлетворяет соотношению Морса [21,22,36]

 $n-b+r-c=0; c \ge 1, r \ge 3, b \ge 3, n \ge 1, (2)$

где n, b, r и c — количество критических точек типа nucleus, bond, ring и cage соответственно.

	Тип критической	<i>N</i> _c , тип	x	y	z	$\lambda_1, e/Å^5$	λ_2 , e/Å ⁵	λ_3 , e/Å ⁵	$\nabla^2 \rho_c$, e/Å ⁵	ρ_c , $e/Å^3$
	ТОЧКИ	позиции				.,	27	5,	, , ,	, .,
Ge	nucleus	8a	0.0	0.0	0.0	-	-	-	_	_
	bond	16c	0.875	0.875	0.125	-1.581	-1.581	0.914	-2.248	0.549
	ring	16d	0.625	0.875	0.875	-0.039	0.153	0.153	0.267	0.026
	cage	8b	0.500	0.000	0.000	0.054	0.054	0.054	0.162	0.014
Sb	nucleus	2c	0.234	0.234	0.234	_	_	_	_	_
	bond	3d	0.000	0.000	0.500	-0.907	-0.890	1.327	-0.469	0.372
	>	3e	0.500	0.500	0.000	-0.359	-0.349	1.174	0.466	0.167
	ring	6h	0.748	0.300	0.748	-0.090	0.235	0.248	0.394	0.053
	cage	1b	0.500	0.500	0.500	0.015	0.090	0.090	0.196	0.021
	*	1a	0.000	0.000	0.000	0.045	0.045	0.086	0.176	0.018
Te	nucleus	3a	0.263	0.000	0.333	_	-	_	_	-
	bond	3b	0.128	0.128	0.500	-1.140	-1.081	1.900	-0.320	0.435
	>	6c	0.124	0.619	0.506	-0.317	-0.291	1.240	0.632	0.140
	ring	3a	0.254	0.254	1.000	-0.071	0.218	0.251	0.398	0.042
	>	6c	0.464	0.789	0.636	-0.059	0.089	0.263	0.294	0.035
	cage	3b	0.627	0.627	0.500	0.006	0.041	0.090	0.137	0.013
Sb ₂ Te ₃	nucleus	1a	0.00	0.000	0.00	-	-	-	_	-
	>	2c	0.211	0.211	0.211	—	_	—	—	_
	>	2c	0.400	0.400	0.400	—	_	—	—	_
	bond	6h	0.416	0.890	0.416	-0.882	-0.878	1.788	0.029	0.342
	>	6h	0.208	0.208	0.687	-0.564	-0.553	1.580	0.463	0.234
	>	3d	0.500	0.000	0.000	-0.206	-0.202	0.990	0.582	0.103
	ring	6h	0.618	0.099	0.099	-0.106	0.248	0.318	0.460	0.058
	>	3e	0.500	0.500	1.000	-0.092	0.094	0.411	0.413	0.053
	>	6h	0.276	0.875	0.276	-0.056	0.137	0.230	0.311	0.035
	cage	2c	0.096	0.096	0.096	0.012	0.090	0.090	0.193	0.020
	>	2c	0.302	0.302	0.302	0.042	0.069	0.069	0.179	0.018
	>	1b	0.500	0.500	0.500	0.032	0.035	0.035	0.102	0.010

Таблица 2. Параметры критических точек распределения электронной плотности в кристаллах Ge, Sb, Te и Sb₂Te₃

Из табл. 2 следует, что знаки и величины главных значений кривизны $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, лапласиана $\nabla^2 \rho_b$ и электронной плотности ρ_b в критических точках типа bond в Ge, в соответствии с простейшей классификацией типов химической связи [21,22], подтверждают общепринятое представление о Ge как о соединении с высокой степенью ковалентности.

Несмотря на то что лапласиан электронной плотности отрицателен $\nabla^2 \rho_b < 0$ в критических точках bond первого типа, занимающих *d*-позиции в кристаллической структуре Sb, соотношения между абсолютными величинами главных значений кривизны $|\lambda_{1,2}| < \lambda_3$ для данных критических точек не удовлетворяют условиям простейшей классификации, как для ковалентного, так и для ионного типов связи в кристалле [21,22]. У критических точек bond второго типа, находящихся в *е*-позициях кристаллической структуры Sb, $\nabla^2 \rho_b > 0$, а соотношения между абсолютными величинами главных значений кривизны такие же, как у критических точек bond первого типа. Данные параметры главных значений кривизны распределения электронной плотности в критических точках типа bond в кристалле Sb, а также знаки и значения лапласиана $\nabla^2 \rho_b > 0$ могут рассматриваться как характерные для полуметалла.



Рис. 1. Парциальные плотности состояний *s*- и *p*-электронов на один атом, а также полная плотность электронных состояний в ячейке кристалла Те.

0.00 \0.019 0.010× 0.019 -0.01-7 -0.01.7a 0.0013 0'010 -0.0072 0.0073 -0.0072 0.010 0.00.00130.019 0.00004 0.010 <u>0</u>.00004 0.011 0.00004 0.001 0.0013 0.044 0.010 0.010 0072 .029 .028 0.0072.028 .05 0.0-0.0072ò 019 0.01 0.032 0.41 0.24 __0.032 -0.032 0.032 0.0004 0.032 0.032 0.0004 0.068 -0.032 0.0004 0.0004 0.068 29 0.032 0.032 0.0

Рис. 2. Линии уровня распределения электронной плотности в плоскости кристалла Те, содержащей критические точки типа bond и cage. *a* — вклад *s*-электронов, *b* — вклад *p*-электронов, *c* — вклад *s*- и *p*-электронов, *d* — полная электронная плотность. Цифры около линий показывают значение электронной плотности на данной линии уровня в единицах e/Å³.

На рис. 1 показаны парциальные и суммарная плотности электронных состояний s- и p-электронов валентной полосы Те. Из данного рисунка следует, что с точностью до нескольких процентов вклады от s- и p-электронов в электронную плотность Те можно разделить. В области энергий от 0 до -6 eV, основной вклад в которую дают р-электроны Те, вследствие дисперсии зон, разделение их на две области — зоны связывающих р-электронов с энергией от -6 до -3 eV и область неподеленной пары (от -3 до 0 eV), которое предлагалось в ранних работах по расчетам электронной структуры Те (см., например, [37]), может быть выполнено лишь с существенной ошибкой. Вследствие этого, вклад валентных р-электронов в распределение электронной плотности вблизи критических точек типа bond в кристалле Те оценивался нами без разделения на подобласти.

На рис. 2 представлено распределение электронной плотности от s- и p-электронов Те в кристаллической плоскости, которая параллельна плоскости (a, b) системы координат и пересекает ось c на половине высоты. В этой плоскости в пределах границы элементарной ячейки, обозначенной двумя наклонными пунктирными линиями, лежит одна из трех седловых критических точек bond первого типа с координатами (0.128, 0.128, 0.5), которая находится на середине расстояния между двумя ближайшими атомами Те,

принадлежащими одному витку спиральной структуры кристалла Те [30]. Вблизи данной плоскости находятся две из шести седловых критических точек bond второго типа с координатами (0.124, 0.619, 0.506) и (0.619, 0.124, 0.494), которые обеспечивают связь между спиралями из атомов Те. В данной плоскости также располагается одна из трех критических точек типа саде с координатами (0.627, 0.627, 0.500). На рис. 2, d дано распределение полной электронной плотности от s- и p-электронов Те в указанной плоскости, показанное с помощью линий уровня. Максимумы электронной плотности, между которыми находятся седловые критические точки bond первого и второго типа, происходят от атомов Те с координатами (0.263, 0.0, 0.333) и (0.0, 0.263, 0.667), которые располагаются ниже и выше плоскости рисунка. На рис. 2, *а*-*с* изображены соответственно парциальные вклады от s, p и суммарный вклад от s- и p-электронов в электронную плотность седловых критических точек bond первого и второго типа, полученные методом CDD. Из рис. 2, а и b следует, что в электронную плотность критической точки bond первого типа s-электроны Те дают больший вклад, чем р-электроны, в то время как электронная плотность в критических точках bond второго типа обусловлена, главным образом, вкладом р-электронов. В ранних работах по расчету электронной зонной структуры Те



Рис. 3. Отношения главных значений кривизны $|\lambda_{1,2}| < \lambda_3$ в критических точках распределения электронной плотности типа bond для Ge, Sb, Te и Sb₂Te₃.

вкладом *s*-электронов в образование связи между атомами Те, находящимися внутри одной спирали, обычно пренебрегали [37].

Несмотря на то что Те является полупроводником, параметры лапласиана и значения электронной плотности в критических точках типа bond для Те близки к значениям соответствующих параметров у полуметалла Sb.

Как следует из табл. 2, у всех трех критических точек типа bond в распределении электронной плотности в кристалле Sb₂Te₃ лапласиан положителен $\nabla^2 \rho_b > 0$ и соотношения между главными значениями кривизны $|\lambda_{1,2}| < \lambda_3$ аналогичны тем, которые были найдены для Sb и Te.

Если пренебречь небольшой эллиптичностью в распределении электронной плотности вблизи критических точек типа bond в Sb, Te и Sb₂Te₃ и приближенно считать, что $|\lambda_1| \approx |\lambda_2|$ для данных веществ, то можно использовать отношение $|\lambda_{1,2}|/\lambda_3$ для критических точек типа bond как некоторую характеристику степени ковалентности химической связи в веществе [20–22]. Из рис. 3, на котором представлено данное отношение для всех критических точек типа bond в исследованных нами веществах, следует, что химическая связь в соединении Sb₂Te₃ обладает наименьшей степенью ковалентности.

Кристаллическая структура Sb_2Te_3 имеет ромбоэдрическую симметрию с пятью атомами в элементарной ячейке [31]: атомы Te_1 занимают позиции типа 1a, атомы Te_2 и Sb — позиции типа 2c. Но структуру Sb_2Te_3 также часто (см., например, [38]) представляют в гексагональных осях в виде 15-слойной структуры, изображенной на рис. 4 и состоящей из трех наборов по пять слоев атомов в каждом (так называемые "quintuple layers of atoms"). Квинтет образуют слои с четвертого

по восьмой и с девятого по тринадцатый. На рис. 4 показаны 3 набора ближайших расстояний между атомами в структуре Sb₂Te₃, представленные в виде линий, соединяющих атомы. Критические точки типа bond в распределении электронной плотности находятся между атомами: Sb-Te₂ (первый набор критических точек типа bond), Sb-Te₁ (второй набор) и Te₂-Te₂ (третий набор). Они располагаются в плоскостях, параллельных плоскости гексагональных осей (a, b) и перпендикулярных оси с. Каждый из атомов имеет по 3 ближайших соседних атома и соответственно 3 критические точки типа bond. Первые два набора критических точек типа bond в структуре Sb₂Te₃ характеризуют связь между атомами внутри квинтета атомных слоев, в то время как третий набор критических точек типа bond определяет параметры существенно более слабой связи между квинтетами. Распределение электронной плотности в трех плоскостях Sb₂Te₃, в каждой из которых содержится по три критические точки типа bond, представлено на рис. 5. На рис. 5, а-с показано распределение полной



Рис. 4. Кристаллическая структура соединения Sb₂Te₃ в гексагональных координатных осях.



Рис. 5. Линии уровня распределения электронной плотности в плоскостях кристаллической структуры соединения Sb₂Te₃, содержащих критические точки типа bond. a, b и c — полная электронная плотность, d, e и f — электронная плотность, полученная методом CDD.

электронной плотности и на рис. 5, d-f — распределение электронной плотности от s- и p-электронов атомов Sb и Te, полученное методом CDD. Рис. 5, а и d представляет распределение электронной плотности для первого набора критических точек типа bond, рис. 5, b и e — для второго набора и рис. 5, c и f — для третьего набора. Плоскости, содержащие критические точки типа bond, проведены параллельно плоскости (a, b) системы координат в гексагональных осях на высоте 0.574 с для первой тройки идентичных критических точек типа bond, на высоте 0.632 с — для второй тройки и 0.167 с для третьей тройки критических точек типа bond в распределении электронной плотности в кристаллической структуре Sb₂Te₃. На рис. 5, a-c максимумы в распределении электронной плотности в плоскостях рисунка происходят от атомов, лежащих выше и ниже плоскостей, в которых располагаются критические точки типа bond. На рис. 5, d и e, полученных методом CDD, отчетливо видны три критические точки в виде максимумов в распределении электронной плотности. Расположение линий уровня электронной плотности на рис. 5, f заметно отличается от такового на рис. 5, d и e. Видно, что в данной плоскости нет явно выраженных максимумов электронной плотности, обеспечивающей связь между квинтетами в структуре Sb₂Te₃. Данная плоскость является плоскостью скола для кристалла. Тем не менее из табл. 2 и рис. 3 можно сделать вывод, что связь между квинтетами из слоев атомов в структуре Sb₂Te₃ не является ван-дер-ваальсовой, как предполагалось в значительной части работ, посвященных исследованию электронной структуры Sb₂Te₃ и Bi₂Te₃, a, скорее, имеет признаки, характерные для полуметалла.

Заключение 4.

Расчеты электронной зонной структуры полупроводников Ge и Te, полуметалла Sb и соединения Sb₂Te₃, проведенные с помощью программного комплекса WIEN2k, основанного на методе функционала электронной плотности, позволили найти параметры критических точек в распределении электронной плотности для указанных веществ. Показано, что химическая связь в Те и Sb₂Te₃ имеет существенно меньшую степень ковалентности, чем в Ge, и близка по характеру к связи в полуметаллической сурьме. Найденные особенности в распределении электронной плотности в кристаллической структуре соединения Sb2Te3 могут быть использованы для объяснения необычных свойств класса псевдобинарных сплавов (GeTe)_m – (Sb₂Te₃)_n, к которому принадлежит Sb₂Te₃, а также служить признаком для поиска новых веществ, обладающих свойствами РСМ.

Авторы выражают благодарность И.А. Ткаченко за помощь в настройке пакета программ WIEN2k на многоцелевом вычислительном комплексе НИЦ "Курчатовский институт" и Е.А. Марьину за помощь в подготовке иллюстраций.

Список литературы

- [1] C. Wood. Rep. Prog. Phys. 51, 459 (1988).
- [2] D. Hsieh, Y. Xia, D. Qian, L. Wray, J.H. Dil, J. Osterwalder, L. Patthey, A,V. Fedorov, H. Lin, A. Bansil, D. Grauer, Y.S. Hor, R.J. Cava, M.Z. Hasan. Phys. Rev. Lett. 103, 146401 (2009).
- [3] M. Wuttig, N. Yamada. Nature Mater. 6, 824 (2007).
- [4] T. Siegrist, P. Merkelbach, M. Wuttig. Ann. Rev. Condens. Matter Phys. 3, 215 (2012).
- [5] V.L. Deringer, R. Dronkowski, M. Wuttig. Adv. Funct. Mater. 25, 6343 (2015).
- [6] N. Yamada, E. Ohno, K. Nishiuchi, N. Akahira, M. Takao. J. Appl. Phys. 69, 2849 (1991).
- [7] J.H. Coombs, A.P.J.M. Jongenelis, W. van Es-Spiekman, B.A. Jacobs. J. Appl. Phys. 78, 4906 (1995).
- [8] M.H. Lankhost, B.W. Ketelaars, R.A. Wolters. Nature Mater. 4, 347 (2005).
- [9] F. Xiong, A.D. Liao, D. Estrada, E. Pop. Science 232, 568 (2011).
- [10] G. Lucovsky, R.M. White. Phys. Rev. B 8, 660 (1973).
- [11] K. Shportko, S. Kremers, M. Woda, D. Lencer, J. Robertson, M. Wuttig. Nature Mater. 7, 653 (2008).
- [12] L. Pauling. The Nature of the Chemical Bond. 3rd ed. Cornell U.P., Ithaca, N.Y. (1960).
- [13] P. Hohenberg, W. Kohn. Phys. Rev. 136, B864 (1964).
- [14] W. Kohn, L.J. Sham. Phys. Rev. 140, A1133 (1965).
- [15] W. Wełnic, A. Pamungkas, R. Detemple, C. Steimer, S. Blügel, M. Wuttig. Nature Mater. 5, 56 (2006).
- [16] M. Wuttig, D. Lüsebrink, D. Wamwangi, W. Wełnic, M. Gilleßen, R. Dronskowski. Nature Mater. 6, 122 (2007).
- [17] A.V. Kolobov, M. Krbal, P. Fons, J. Tominaga, T. Uruga. Nature Chem. 3, 311 (2011).
- [18] A.V. Kolobov, P. Fons, J. Tominaga, S.R. Ovshinsky. Phys. Rev. B 87, 165206 (2013).
- [19] A.V. Kolobov, P. Fons, J. Tominaga, M. Hase. J. Phys. Chem. C 118, 10248 (2014).
- [20] R.F.W. Bader. In: Atoms in Molecules: A Quantum Theory. Int. Series of Monographs on Chemistry 22. Oxford Science Publications, Oxford (1990).
- [21] C. Gatti. Z. Kristallogr. 220, 399 (2005).
- [22] The Quantum Theory of Atoms in Molecules. From Solid State to DNA and Drug Design / Ed. C.F. Matta, R.J. Boyd. WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim (2007).
- [23] P. Blaha, K. Schwarz, G.K.H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz. WIEN2k, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties (Karlheinz Schwarz, Techn. Universität Wien, Austria) (2001). ISBN 3-9501031-1-2.
- [24] F. Tran, P. Blaha. Phys. Rev. Lett. 102, 226401 (2009).
- [25] H. Dixit, R. Saniz, S. Cottenier, D. Lamoen, B. Patroens. J. Phys.: Condens. Matter 24, 205503 (2012).
- [26] http://computing.kiae.ru/
- [27] A. Otero-de-la-Roza, E.R. Johnson, V. Luaña. Comp. Phys. Commun. 185, 1007 (2014).

- [28] J.F.C. Baker, M. Hart. Acta Cryst. A 31, 364 (1975).
- [29] C.S. Barrett, P. Cucka, K. Haefner. Acta Cryst. 16, 451 (1962).
- [30] R. Keller, W.B. Holzapfel, H. Schulz. Phys. Rev. B 16, 4404 (1977).
- [31] T.L. Anderson, H.B. Krause. Acta Cryst. B 30, 1307 (1974).
- [32] G.G. Macfarlane, T.P. McLean, J.E. Quarrington, V. Roberts. Phys. Rev. 108, 1377 (1957).
- [33] P. Grosse. Springer Tracts in Modern Physics. V. 48. Springer-Verlag, Berlin (1969).
- [34] R. Sehr, L.R. Testardi. J. Phys. Chem. Solids 23, 1219 (1962).
- [35] International Tables for Crystallography. Volume A. Spacegroup symmetry / Ed. Th. Hahn. Springer (2005).
- [36] M. Morse, S.S. Cairns. In: Critical point theory in global analysis and differential geometry. Academic Press, N.Y. (1969).
- [37] J.D. Joannopoulos, M. Schlütter, M.L. Cohen. Phys. Rev. B 11, 2186 (1975).
- [38] G. Wang, T. Cagin. Phys. Rev. B 76, 075201 (2007).